

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

МАГНА ТМ 300

Назначение: Нанесение металлических или диэлектрических тонких пленок на подложки (пластины) методом магнетронного распыления.



Особенности:

- Обработка подложек до \varnothing 300 мм в одном технологическом цикле;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек на носителе из кассеты в кассету;
- Транспортная система переноса подложек на носителе из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Нагреваемый ВЧ столик;
- Мультикатодное МРУ с тремя мишенями \varnothing 150 мм;
- Нанесение из трех магнетронов одной пленки или последовательное нанесение двух-, трехслойных пленок с использованием заслонки;
- Безмасляная система откачки;
- Мощность потребления не более 16 кВт;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

